

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

訂正版

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月1日(01.05.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/088837 A9

(51) 国際特許分類:

C09K 3/14 (2006.01) C09G 1/02 (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/021564

(22) 国際出願日: 2024年6月13日(13.06.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願 2023-184172 2023年10月26日(26.10.2023) JP

(71) 出願人: T O P P A N インフォメディア株式会社(TOPPAN INFOMEDIA INC.) [JP/JP]; 〒1080023 東京都港区芝浦三丁目19番26号 (JP).

(72) 発明者: 三橋 正輝(MITSUHASHI,Masaki); 〒1080023 東京都港区芝浦三丁目19番26号 T O P P A N インフォメディア株式会社内 (JP).

(74) 代理人: アクシス国際弁理士法人(AXIS PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号 新橋アイマークビル (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告(条約第21条(3))
- 規則91.3(b)の規定に基づく明白な誤記の訂正の許可に関する情報(規則48.2(i))

(48) この訂正版の公開日:

2025年8月14日(14.08.2025)

(54) Title: POLISHING SLURRY

(54) 発明の名称: 研磨スラリー

(57) Abstract: Provided is a polishing slurry that can make it possible to more efficiently obtain, at a high polishing speed, a polished surface having good surface characteristics even for objects to be polished having relatively low mechanical strength. The polishing slurry contains α -alumina as polishing particles in an aqueous medium. The α -alumina has a mean particle diameter (D50) at a 50% cumulative volume basis in particle size distribution obtained by a laser diffraction scattering method of 80-120 nm, has a specific surface area (BET) measured on the basis of the JIS-Z8830 (2013) specification of 20 m²/g or more, and has a ratio (BET/D50) of the specific surface area (BET) to the mean particle diameter (D50) of 1.5 m²/g $\times 10^{-4}$ or more.

(57) 要約: 機械的強度が比較的低い研磨対象物に対しても表面特性の良好な研磨面を高い研磨速度でより効率良く得ることが可能な研磨スラリーを提供する。水性媒体中に研磨粒子として α -アルミナを含有し、 α -アルミナが、レーザー回折散乱法によって求められる粒度分布における体積基準積算値50%での平均粒子径(D50)が80~120nmであり、JIS-Z8830(2013)の規定に基づき測定した比表面積(BET)が20m²/g以上であり、比表面積(BET)と平均粒子径(D50)との比率(BET/D50)が1.5m²/g $\times 10^{-4}$ 以上である研磨スラリーである。

[続葉有]

- (15) 訂正情報 :
2025年8月14日(14.08.2025) の更新情報
(Notice) を参照